

## 8 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価

### 8.7 日影



## 8.7 日影

## 8.7.1 現況調査

## (1) 調査事項及びその選択理由

調査事項及びその選択理由は、表 8.7-1に示すとおりである。

表 8.7-1 調査事項及びその選択理由：日影

調査事項	選択理由
①日影の状況 ②日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等の状況 ③既存建築物の状況 ④地形の状況 ⑤土地利用の状況 ⑥法令による基準等	工事の完了後において、計画建築物等による日影の状況の変化による影響が考えられる。 以上のことから、計画地について、左記の事項に係る調査が必要である。

## (2) 調査地域

調査地域は、図 8.7-1に示すとおりである。冬至日における煙突（地上からの高さ約150m）の影の最大倍率（真太陽時の8時及び16時で約7倍）を考慮し、1.5km×3kmの範囲とした。

## (3) 調査方法

## ア 日影の状況

調査は、既存資料の整理・解析及び現地調査により行った。また、主要な地点における日影の状況については、天空写真の撮影を行い、天空図を作成して把握した。

調査位置は、表 8.7-2及び図 8.7-2に示すとおり、計画地敷地境界周辺の4地点とした。なお、調査（撮影）時の諸データは、表 8.7-3に示すとおりである。

表 8.7-2 調査地点及び調査（撮影）年月日

調査地点		調査（撮影）年月日
1	敷地境界周辺北側（約6m）	平成28年12月19日
2	敷地境界周辺東側（約3m）	平成28年12月19日
3	敷地境界周辺西側（約12m）	平成28年12月19日
4	敷地境界周辺北西側（約0m）	平成28年12月19日

注）調査地点の括弧内は敷地境界からの距離を示す。

表 8.7-3 調査（撮影）時の諸データ

項目	内容
使用カメラ	Nikon D3
使用レンズ	AI フイッシュアイニッコール 8mmF2.8
撮影画角	180°
仰角	90°
撮影高さ	1.5m

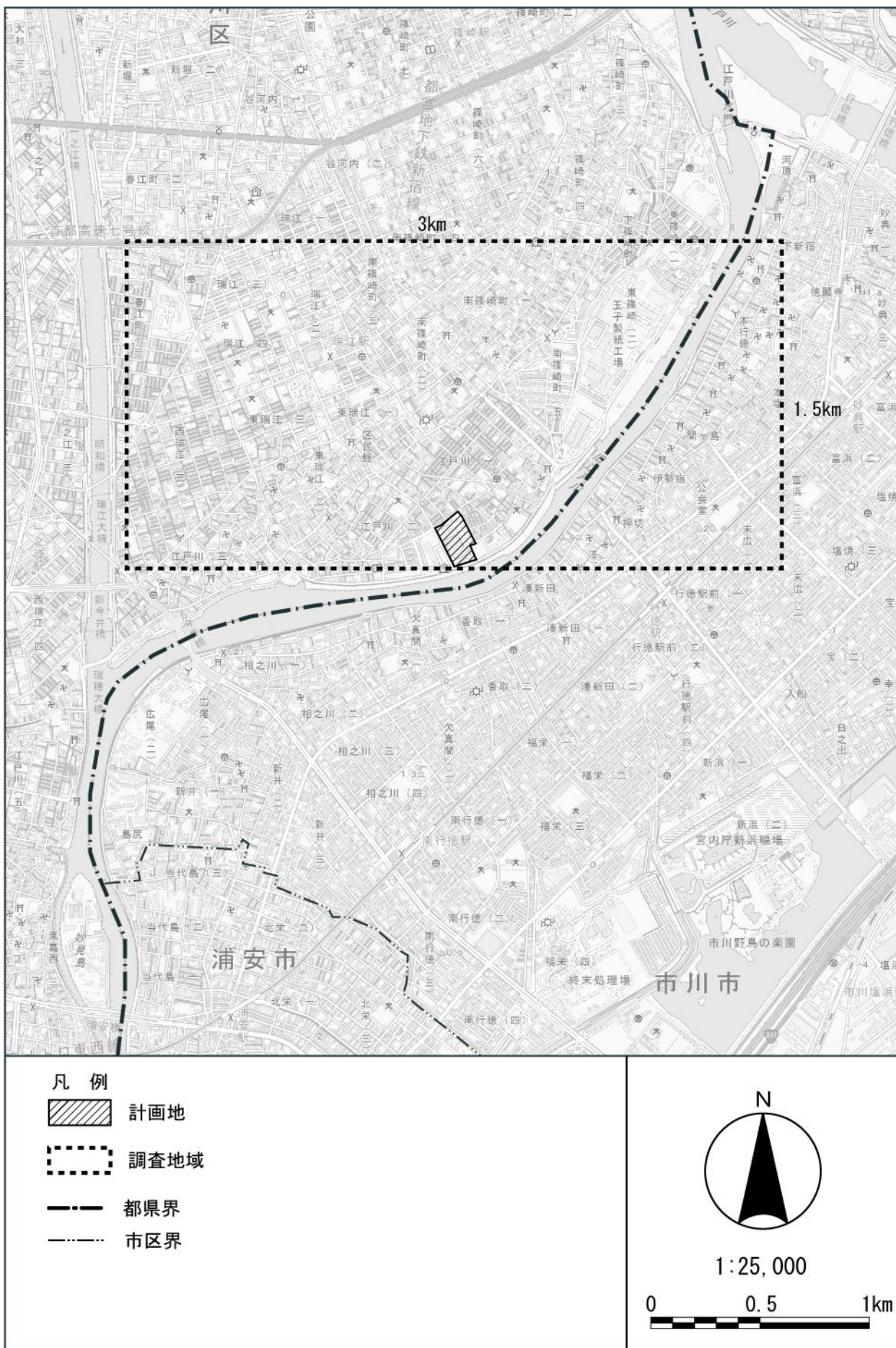
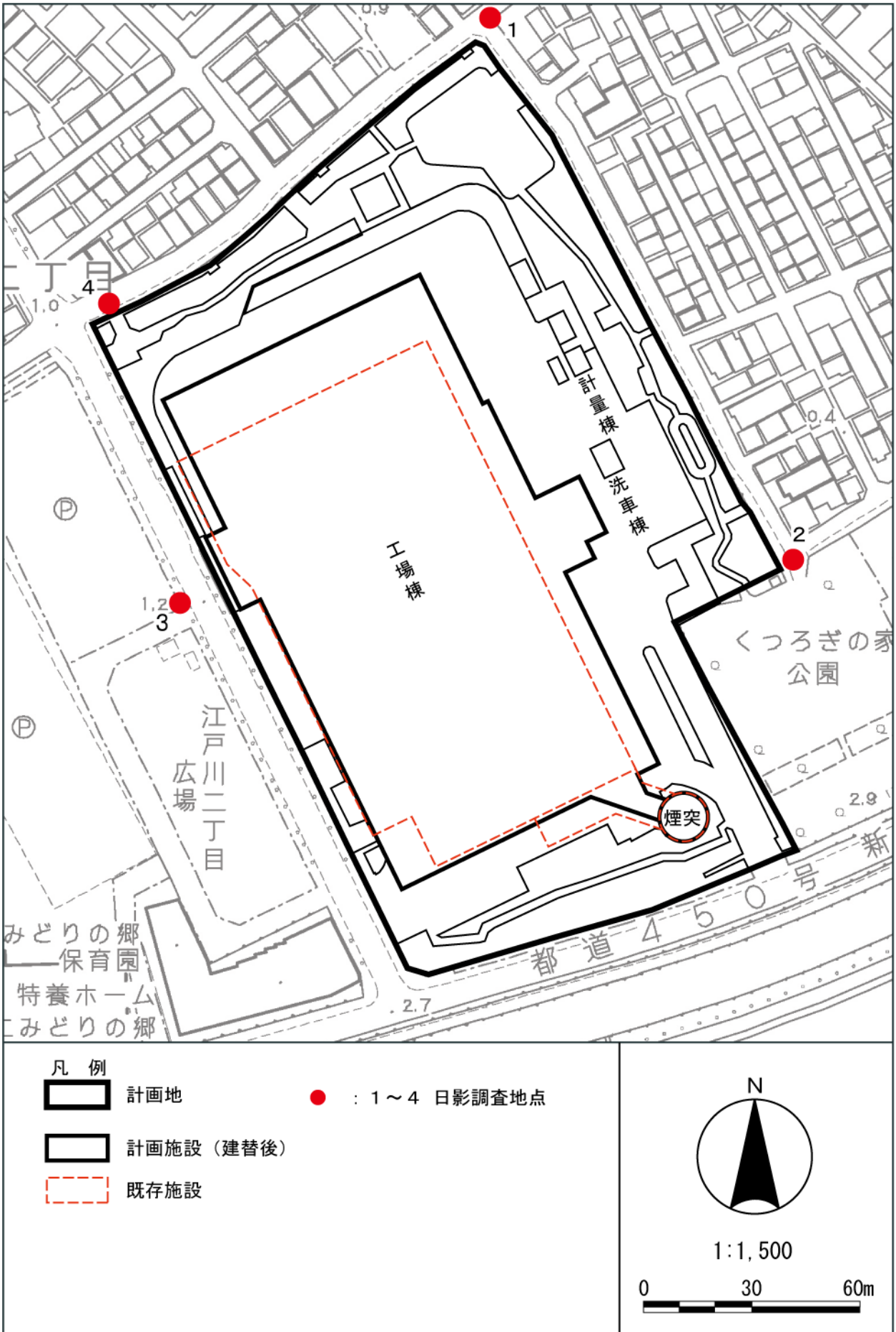


図 8.7-1 日影調査地域





- 凡例
- 計画地
  - 計画施設（建替後）
  - 既存施設
  - : 1～4 日影調査地点

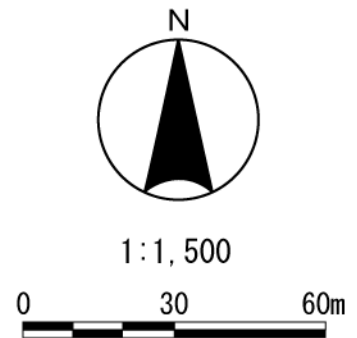


図 8.7-2 日影調査地点

**イ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等の状況**

既存資料の整理・解析及び現地調査により行った。

**ウ 既存建築物の状況**

既存資料の整理・解析及び現地調査により行った。

**エ 地形の状況**

既存資料の整理・解析を行った。

**オ 土地利用の状況**

既存資料の整理・解析を行った。

**カ 法令による基準等**

関係法令による基準等を調査した。

**(4) 調査結果**

**ア 日影の状況**

**(7) 計画地周辺の日影の状況**

計画地周辺には、計画地の北西側に地上12階建ての共同住宅、西側に地上14階建ての共同住宅がある。そのため、計画地周辺は平坦地ではあるが、共同住宅等により日影が生じている。

**(4) 主要な地点における日影の状況**

計画地周辺の主要な地点における現況の日影状況は、写真8.7-1～写真8.7-4に示すとおりである。

**イ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等の状況**

計画地周辺の公共施設等は、表 7.3-8(1)及び(2)、図 7.3-8 (p.85～p.87参照)に示したとおり、計画地の南西側に近接してみどりの郷保育園及び特別養護老人ホーム第二みどりの郷が存在するとともに、計画地の南東側には江戸川区立くつろぎの家がある。

また、計画地周辺の住宅は、計画地の東～北～北西側にかけて低層の住宅がある。

計画地周辺の公園等は、表7.3-9(1)～(3)、図 7.3-9 (p.88～p.91参照)に示したとおり、計画地の南西側に近接して江戸川二丁目広場が存在するとともに、計画地の南東側にはくつろぎの家公園がある。

計画地周辺の指定文化財は資料編 (p.241～243参照)に示すとおり、計画地北側で最も近い文化財は「成田山不動明王石造道標 (江戸川区登録有形文化財)」であり、計画地敷地境界から北西約350mに位置している。

**ウ 既存建築物の状況**

計画地周辺の既存建築物(高層建築物)の分布状況は、図 8.7-3に示すとおりである。

計画地の北西側に地上12階建ての共同住宅、西側に地上14階建ての共同住宅がある。



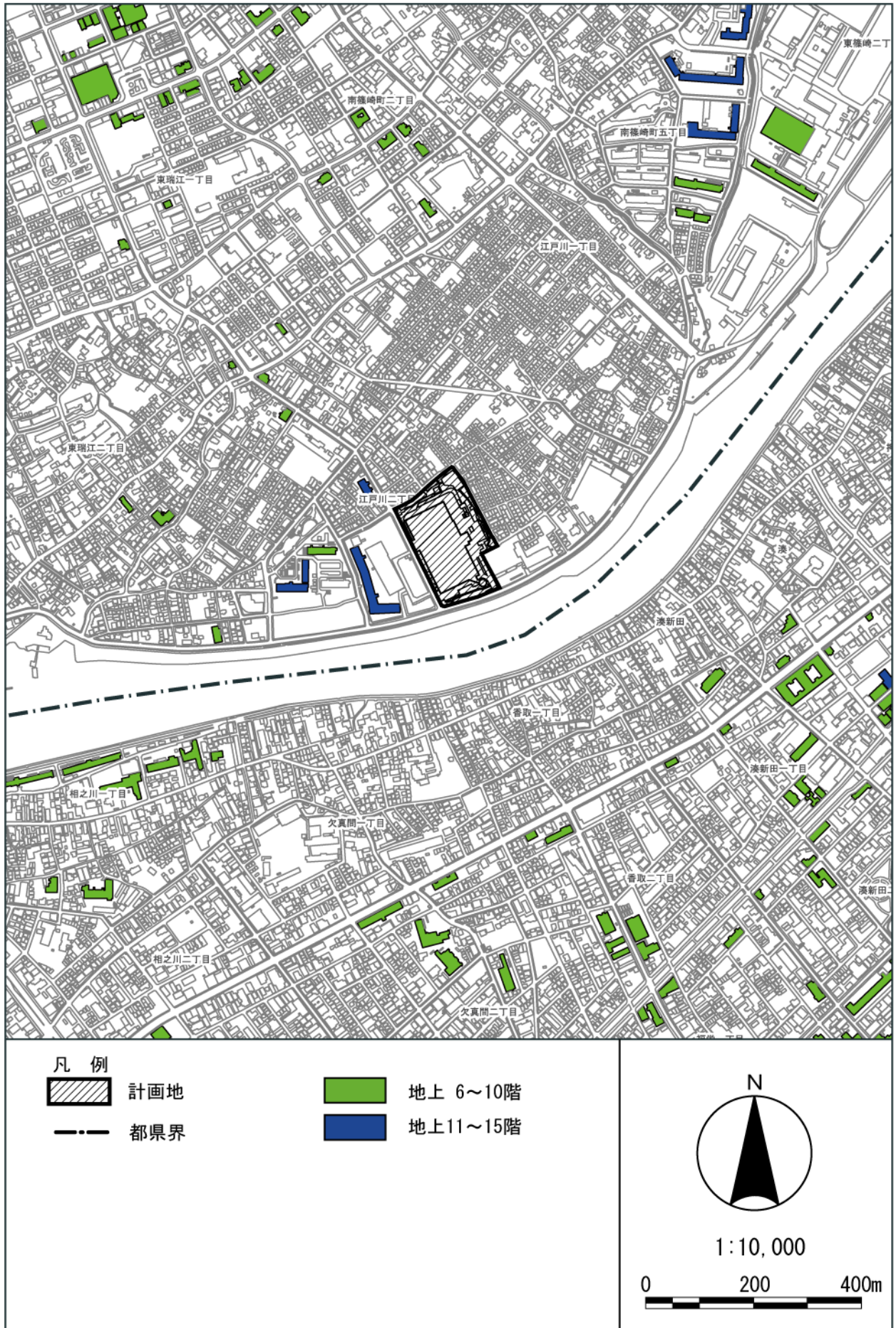


図 8.7-3 高層建築物の分布状況



## エ 地形の状況

計画地周辺の地形の状況は「8.5 地盤」の「8.5.1 現況調査 (4) 調査結果 ア 地盤の状況 (ア)低地、台地等の地形の状況」(p. 354及びp. 355参照)に示したとおりである。

## オ 土地利用の状況

計画地周辺の土地利用の状況は「7.3 (参考) 地域の概況」の「7.3.1 一般項目 (4) 土地利用」(p. 77～p. 91参照)に示したとおりである。

## カ 法令による基準等

「建築基準法」、「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」及び「江戸川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に基づく、計画地周辺の日影規制区域の指定状況は、図 7.3-7(1)及び(2)(p. 82及びp. 83)、表 8.7-4に示すとおりである。

なお、江戸川区の一部の区域は「江戸川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に基づく日影規制区域であり、計画地の北から東側に隣接する江戸川一丁目地区もこれに該当する。当該区域については計画建築物による日影は規制の対象外となるが、予測結果の評価の指標として用いた。

表 8.7-4 日影規制の状況（江戸川区）

用途地域等			日影規制				
地域	高度地区	容積率 (%)	規制を受ける建築物	規制値	規制時間		測定面
					5mを超え10m以下	10mを超える範囲	
第一種低層住居専用地域	第一種	60, 80	軒高が7mを超えるまたは地上3階建て以上の建築物	(一)	3.0時間	2.0時間	1.5m
		100		(二)	4.0時間	2.5時間	
第一種中高層住居専用地域	第一種	100	高さが10mを超える建築物	(一)	3.0時間	2.0時間	4.0m
	第二種	100, 150		(二)	4.0時間	2.5時間	
	第二種の一部区域 <sup>※1</sup>	150					
第二種、第三種	200	(一)		3.0時間	2.0時間		
第二種中高層住居専用地域	第二種	150		(二)	4.0時間	2.5時間	
	第二種の一部区域 <sup>※2</sup>						
第一種住居地域	第二種、第三種	200	(一)	4.0時間	2.5時間		
	第二種の一部区域 <sup>※3</sup>		(二)	5.0時間	3.0時間		
	第三種 <sup>※4</sup>	300	規制対象外				
	無指定		400				
近隣商業地域	第二種、第三種	200	高さが10mを超える建築物	(一)	4.0時間	2.5時間	4.0m
	第三種 <sup>※5</sup>	300		(二)	5.0時間	3.0時間	
	第三種	400	規制対象外				
	無指定	300, 400					
準工業地域（特別工業地区、特別業務地区を含む）	第二種 <sup>※6</sup>	200	高さが10mを超える建築物	(一)	4.0時間	2.5時間	4.0m
	第二種の一部区域 <sup>※7</sup>			(二)	5.0時間	3.0時間	
	無指定						
	第三種 <sup>※8</sup>	300		規制対象外			
商業地域	第三種	400	規制対象外				
	無指定	400, 500, 600					
工業地域	無指定	200	規制対象外				
地区計画条例による規制							
春江町三丁目南、西瑞江三丁目北、江戸川一丁目			高さが10mを超える建築物	—	4.0時間	2.5時間	4.0m
瑞江駅西部				—	5.0時間	3.0時間	

備考) 高度地区の欄中「第一種」、「第二種」、「第三種」は、それぞれ以下の地区を示す。

第一種：第一種高度地区

第二種：第二種高度地区、16m第二種高度地区

第三種：第三種高度地区

注) 計画地は下線で示す準工業地域であり、網掛けは計画地に該当する規制等である。

※1：北小岩四丁目、北小岩五丁目、北小岩六丁目、北小岩七丁目、北小岩八丁目、西小岩一丁目、西小岩二丁目、東小岩一丁目、東小岩二丁目、東小岩四丁目、南小岩一丁目、南小岩二丁目、南小岩四丁目、南小岩五丁目、南小岩六丁目、鹿骨一丁目、鹿骨四丁目、鹿骨五丁目、鹿骨六丁目、上一色二丁目、上一色三丁目、興宮町、一之江二丁目、一之江五丁目、西一之江一丁目、西一之江二丁目、西一之江三丁目、西一之江四丁目及び船堀七丁目の各地内の区域

※2：鹿骨一丁目、鹿骨五丁目、鹿骨六丁目及び船堀七丁目の各地内の区域

※3：松島四丁目の地内の区域

※4：西小岩四丁目及び西小岩五丁目の各地内の区域を除く。

※5：西小岩三丁目及び西小岩四丁目の各地内の区域を除く。

※6：東葛西三丁目の地内の区域を除く。

※7：臨海町一丁目、臨海町二丁目、臨海町五丁目及び臨海町六丁目の各地内の区域

※8：小松川一丁目の地内の区域を除く。

資料) 「江戸川区地域地区図/日影規制区域図」(平成29年6月、江戸川区都市開発部)